

제 목 : Plasma Cleaner

발표자 : 김 재 환

소 속 : 대 일 교 역

(TEL : 02-666-4127, FAX : 02-666-4129)

\* 원 리 :

Ar 75%와 Oxygen 25%의 혼합 gas를 사용하여 Low Energy High frequency의 Plasma를 발생하여 아래 그림에서와 같이 plasma cleaner Chamber내에서 Oxygen reaction의 반응으로 Sample 표면의 Hydro Carbon 및 각종 Organic Contamination을 Co, Co<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O,로 치환하여 Vacuum System으로 Pumping 하여 Cleaning한다.

\* APPLICATION :

Sample 표면을 Etching과 Sputtering 없이 Sample 표면의 Hydro Carbon과 기타 Contamination을 제거함으로써 관찰하고자 하는 Sample 표면조직의 파손 없이 아주 향상된 상태의 Image 을 관찰할 수 있고 FETEM, FESEM, EDX, EELS EPMA, AUGER, 등의 Excellent 한 Image, 정성, 정량 Data을 얻을 수 있다.

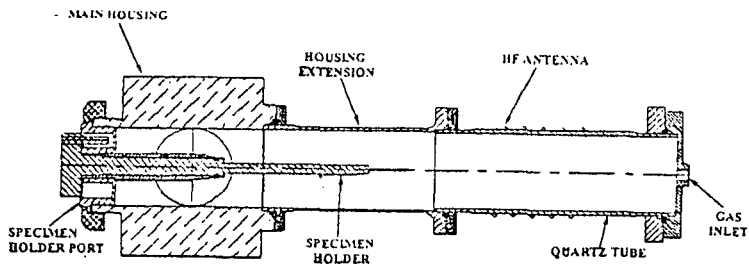


Figure 1. Plasma chamber design.

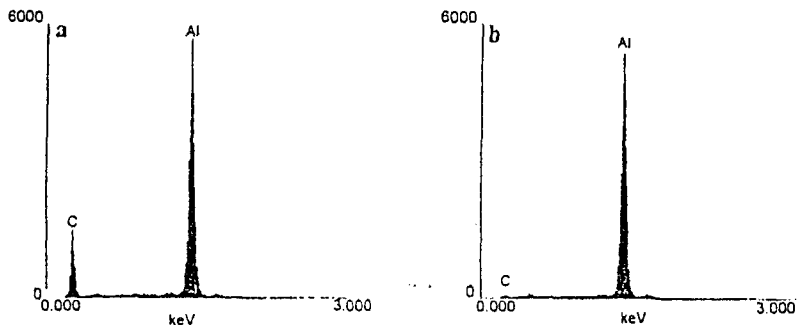


Figure 7. SEM EDS spectra of aluminum a) before and b) after two minutes of plasma cleaning